

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年12月23日(2021.12.23)

【公開番号】特開2020-25070(P2020-25070A)

【公開日】令和2年2月13日(2020.2.13)

【年通号数】公開・登録公報2020-006

【出願番号】特願2019-55846(P2019-55846)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 27/11582 (2017.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/788 (2006.01)

H 01 L 29/792 (2006.01)

H 05 H 1/46 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/302 1 0 5 Z

H 01 L 21/302 1 0 1 C

H 01 L 27/11582

H 01 L 29/78 3 7 1

H 05 H 1/46 L

【手続補正書】

【提出日】令和3年11月10日(2021.11.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0046】

トランスファモジュール12は未処理のウエハWを搬入出部11からプロセスモジュール13に搬入し、処理済みのウエハWをプロセスモジュール13から搬入出部11に搬出する。トランスファモジュール12は内部が真空雰囲気の矩形の筐体からなり、2枚のウエハWを保持して移動する2つの搬送アーム14と、各搬送アーム14を回転可能に支持する回転台23と、回転台23を搭載した回転載置台24と、回転載置台24をトランスファモジュール12の長手方向に移動可能に案内する案内レール25とを含む。また、トランスファモジュール12は、ゲートバルブ22b、さらに後述する各ゲートバルブ26を介して、搬入出部11のロードロックモジュール19、および、各プロセスモジュール13へ接続される。トランスファモジュール12では、搬送アーム14が、ロードロックモジュール19から2枚のウエハWを各プロセスモジュール13へ搬送し、処理が施された2枚のウエハWを各プロセスモジュール13から他のプロセスモジュール13やロードロックモジュール19に搬出する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0053

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0053】

仕切板37の下には、ウエハWに対向するように遮熱板48が設けられている。遮熱板48は、プラズマ生成空間Pでのプラズマ生成を繰り返すことにより仕切板37に熱が蓄

積されるため、その熱が処理空間 S におけるラジカル分布に影響を与えることを抑制するためのものである。遮熱板 4 8 は、仕切板 3 7 よりも大きく形成され、周縁部を構成するフランジ部 4 8 a は処理容器 2 8 の側壁部 2 8 a に埋設されている。なお、フランジ部 4 8 a には冷却機構 5 0、例えば、冷媒流路、チラーやペルチェ素子が埋設されている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 11】

